

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 高野 泰 副委員長 野毛 悟

幹事 佐藤知正・小館淳一 幹事補佐 岩田展幸・坂本 尊

日時 9月4日(木) 13:30~17:10

5日(金) 9:30~13:10

会場 山形大学工学部百周年記念会館セミナールーム 1, 2, 3 (米沢駅前から市街地循環路線右回り(青色)バスで山大正門前下車(約15分). JR米坂線:南米沢駅下車(約4分), 徒歩6分. 米沢駅からタクシーで約10分(約1,700円))

議題 電子部品・材料, 一般

4日

1. 高周波プラズマ化学気相成長法による窒素添加 DLC 薄膜の特性評価
○土屋政人・真柄晃平・徳田健吾・中澤日出樹(弘前大)
2. オフ角 Si(001) 基板上に形成した AlN 層上への SiC ヘテロエピタキシャル成長
○目黒一熙・成田次理・上村駿洋・中澤日出樹(弘前大)
3. プラズマ直接窒化法による SiC 表面の窒化処理と窒化層の熱的安定性
○赤羽桂幸・狩野巧生・荻野航弥・小林悠太・山上朋彦・上村喜一(信州大)
4. 溶液成長法による SnS の堆積条件 山中雄貴・兼森遥平・○高野 泰(静岡大)
5. Co/Pt/Cr₂O₃ 積層膜の結晶構造解析及び磁気特性
隅田貴士・中村拓未・林 佑太郎・橋本浩佑・渡部雄太・永田知子・高瀬浩一・山本 寛・○岩田展幸(日大)
6. パルスレーザー堆積法による Bi 系ペロブスカイト酸化物薄膜の結晶構造と電気的磁気的特性
稲葉隆哲・渡部雄太・大島佳祐・及川貴大・Huaping Song・永田知子・橋本拓也・高瀬浩一・山本 寛・○岩田展幸(日大)
7. コンタクトエピタキシャル法による CexY(3-x)Fe₅O₁₂ の膜の方位制御 野毛 悟(沼津高専)
8. Dielectric and magnetic properties of Gd and Ti co-doped BiFeO₃
○Bashir Ahmmad (Yamagata Univ.)・M.A. Basith・O. Kurni・M.S. Alam (BUET)・B.L. Sinha (Atomic Energ. Cent.)・Fumihiko Hirose (Yamagata Univ.)

5日

1. 減圧 MOCVD 法による非極性窒化ガリウムの成長とその特性
寺口祐介・三宅祐介・西山智哉・玉山泰宏・○安井寛治(長岡技科大)
2. NEA 半導体フォトカソードへの応用を目指した GaN 系半導体の量子効率及び耐久性の研究
○佐藤大樹・西谷智博・本田善央・前川拓也・天野 浩(名大)
3. FDTD 法による有機太陽電池用ハイブリッド反射防止構造の光学解析
○久保田 繁・鹿又健作・有馬ボシルアハンマド(山形大)・水野 潤(早大)・廣瀬文彦(山形大)
4. RT Ga₂O₃ atomic layer deposition by using trimethylgallium and water-oxygen plasma
○P. Pansila・K. Kanomata・B. Ahmmad・S. Kubota・F. Hirose (Yamagata Univ.)
5. Ca₃Co₄O_{9+δ} の熱電特性に及ぼす多重元素同時置換の影響 ○野島崇矢・中村雄一・井上光輝(豊橋技科大)
6. A novel multifunctional smart soft and wet material
○M. Hasnat Kabir・Jin Gong・Hidemitsu Furukawa (Yamagata Univ.)
7. 室温原子層堆積法を用いた防蝕コーティング
○廣瀬文彦・鹿又健作・大場尚志・有馬ボシルアハマド・久保田 繁・平原和弘(山形大)
8. 金属微粒子担持酸化チタンナノチューブマイクロガスセンサ
○木村康男(東京工科大)・戸邊 翼・木村昭太・小島領太・平野愛弓・庭野道夫(東北大)

☆CPM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

10月8日(水) 機械振興会館〔締切済〕テーマ:光記録技術・電子材料, 一般

10月24日(金), 25日(土) 長野駅周辺〔締切済〕テーマ:薄膜プロセス・材料, 一般

11月26日(水)~28日(金) ビーコンプラザ(別府国際コンベンションセンター)[9月7日(日)] テーマ:デザ
インガイア 2014—VLSI 設計の新しい大地—

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>